

国家知识产权局

目 次

- 第一 前回までの要請事項の要旨
- 第二 これまでの経過に対する評価
- 第三 今後の課題

第一 前回までの要請事項の要旨

一．全般

1．審査の促進と適正確保

要請 1

- (1) 審査請求からファーストアクション及び登録までの期間を可能な限り短縮し、その結果について定期的に開示していただきたい。
- (2) 審査手続きを改善していただきたい。

2．優先審査制度、無効審判制度の改善

要請 2

- (1) 優先審査制度を以下に示すように改善していただきたい。
下記のような第三者実施要件などを含む適用の拡大
 - () 実際に出願された発明等を出願人やそのライセンシーが実施し、又は第三者が違法に実施している場合の出願
 - () 貴国へのライセンス供与や投資などを予定している外国関連の出願上記 の場合に出願人等が権利として直接優先審査を請求でき、そのような優先審査の請求があった場合応答いただくこと
- (2) 侵害訴訟が提起されている場合の無効審判の促進に関する制度上、運用上の改善を要請します。

二．特許関係の改善

1．新規性判断における公用に関する世界主義の採用

要請 3

- (1) 特許における新規性阻害要因に外国での公然実施を加えていただきたい。
- (2) インターネット上での公開が新規性阻害要因に該当することを確認していただきたい。

2．新規性喪失の例外の拡大

要請 4

新規性喪失の例外規定に試験及び刊行物公知を加えていただきたい。また、新規性判断に世界主義を採用する場合（要請 3）は、新規性喪失の例外規定にインターネットでの公開及びパリ条約上の博覧会も加えていただきたい。

3. 冒認出願の無効事由としての明示

要請 5

他人の発明を盗み、自己若しくは第三者を発明者であるとした特許出願である冒認出願を、拒絶理由及び無効理由として明示していただきたい。

4. プログラム自体及びビジネス方法の特許としての保護

要請 6

プログラム自体及びコンピュータを用いたビジネス方法の特許できる発明と明示していただきたい。

5. 間接侵害の新設

要請 7

間接侵害について明文で規定していただきたい。

三. 実用新案関係の改善

新規性判断における公用についての世界主義の採用及び権利行使の制限

要請 8

- (1) 実用新案の新規性阻害要因、新規性喪失の例外の拡大、冒認出願の取り扱いについて、前述の特許に関する要請3、4、5と同様の対処をしていただきたい。
- (2) 実用新案権の裁判外での権利主張及び訴え提起段階において、技術評価書の提示を必要とするよう明示していただきたい。
- (3) 何人であっても実用新案技術評価書を請求できるよう条文上明示していただきたい。

四. 意匠関係の改善

新規性についての世界主義、部分意匠の採用、保護期間、権利行使の制限

要請 9

- (1) 意匠の新規性阻害要因、新規性喪失の例外の拡大、冒認出願、間接侵害について前述の特許に関する要請3、4、5、7と同様の対処をしていただきたい。
- (2) 部分意匠制度を導入していただきたい。
- (3) 権利保護期間をより長期化していただきたい。
- (4) 意匠の権利行使に技術評価書の提示を必要としていただきたい。

第二 これまでの経過に対する評価

これまでの要請事項に関して、例えば特許審査期間の短縮などが着実になされており、運用の制度の改善改正検討努力は着実に進捗しているものと思われ、中国側の対応取組に感謝いたします。

また、呉儀副総理が主導する知的財産権保護キャンペーンは、2004年9月から2005年12月まで、全国規模で展開されており、その取組に敬意を表します。

要請事項1(1)について

審査の促進に関しては、審査に要した期間の短縮が着実になされており、その期間のデータも開示されるようになり、中国側の取組を歓迎します。

要請事項1(2)について

審査の適正確保に関しては、拒絶理由通知の内容を見ると、「明らかに不当なもの」は少なくなってきており、中国側の対応を歓迎します。

要請事項3(2)について

中国でもインターネット上での公開情報が新規性を否定する証拠として採用された実績があるとのことであり、現行法令でもインターネット公知が新規性阻害要因に該当するという解釈に基づく運用を行おうとしている中国側の対応を歓迎します。

要請事項5について

他人の発明を自己の発明と偽って出願する冒認については、中国の制度では裁判で解決を図ることになっており、中国政府の対応としては一応合理性を有するものであることを理解しました。しかしながら、日本の企業の技術・デザインが、中国企業により冒認出願されるケースは依然として多く、裁判と比較して簡便かつ低コストな行政手段によって冒認出願に基づく不当な権利の発生を防ぎ、取り消す制度は産業界にとって必要であると考えます。

要請事項6について

ビジネス方法に関し、デバイスと結びついたものについては発明として認められる場合があるとのことであり、そのような運用を行おうとしている中国側の対応を歓迎します。

第三 今後の課題

要請事項1については、分野により大幅な改善が、要請事項3(2), 6については、ある程度の改善が図られたものと考えられますが、その他の要請事項については、中国側でも検討していることを伺っているものの、依然として改善の余地が残されている点が今後の課題と思われま

優先事項1(商品のデザイン模倣品の対策の強化)

以前から要請しておりました外国での公然実施を新規性阻害要因とすることについては、中国側でも検討していると伺っており、是非実現をお願いします。

また、従来要請しているものに加え、意匠の実施行為の一つとして、譲渡、貸し渡し、譲渡又は貸し渡しの申し出、又は譲渡若しくは貸し渡しのための展示を含めていただくようお願いします。

なお、本件については、展示会における「展示」行為が意匠の実施行為に含まれる旨伺っておりますが、意匠において「譲渡又は貸し渡しのための展示」が実施行為として条文上明示されていないために、展示会での展示行為への対応に苦慮しているという報告もあります。

優先事項2(取締りと刑事訴追の強化)

各地方の知識産権局には、紛争処理及び侵害行為を停止するよう命ずることができる権限が与えられていると伺っておりますが、積極的な措置をお願い致します。

また、刑事罰の対象となるものについては、積極的な告発をお願いします。

さらに、取締機関同士の連携を強化していただきますようお願いします。

優先事項3(特定分野の審査促進)

審査の促進に関しては、審査期間の短縮が着実になされており、大幅な改善がなされているものの、分野によっては、ばらつきがあり、先端技術分野では、依然として審査遅延が生じていますので、これら分野の審査促進をお願いします。

今後、日・中で協調の上、さらなる改善協力に取り組んでいきたいと考えます。

以上

中国国家知識産権局への協力

中国国家知識産権局御中

模倣品対策における日・中協力について

国際知的財産保護フォーラム
訪中代表団 団長 宗国 旨英

拝啓 新春の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。

さて、わたくしども国際知的財産保護フォーラム（以下IIPPFF）は2005年1月に貴機関を訪問させていただき、日・中の模倣品対策における友好的な打合せをさせていただきました。

その際にIIPPFFより提案させていただきました協調と支援の内容につきまして技術説明会の開催 について賛同いただきましたことを感謝致します。今後は、この内容をいかに具体的に展開していくかについて打合せをさせていただきますので宜しくお願い申し上げます。

つきましては、 の内容につき展開計画を作成致しましたので、内容を確認いただき、要望などありましたら4月18日からの週にIIPPFFとして再度訪中を予定しておりますので、その面会のときにご意見などをいただきますようお願い致します。

また、貴機関を訪問させていただいた際にお渡ししました書面についての回答を貴機関よりいただきましたことに、お礼申し上げます。

つきましては、上記 以外の貴機関からの要望をいかに具体的に展開していくかについて以下のように回答させていただきますので、内容を確認いただき、要望などありましたら上記と同様に、その面会のときにご意見などをいただきますようお願い致します。

敬具

1. 協調と支援内容の計画について

技術説明会の開催

技術説明会 プロジェクト <展開計画> IIPPFF 第4プロジェクト																	
行政機関	05年												06年				
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
SIPO要望	▽ 要望																
業界検討	▽ 整理																
説明会実施	スケジュール作成																
状況フォロー	スケジュールに応じて個別実施																
	▽ 状況・要望 アンケート																
	継続展開 要否判断																

2005年5月～8月まで 技術説明会を実施する業界をI I P P Fにて検討・準備し、技術説明会実施スケジュールを作成（S I P O要望取り込み）

2005年9月～ スケジュールに応じて技術説明会の個別実施
技術説明会開催後、活用状況などについてアンケートを実施

2. 以外の貴機関からの要望について

< 貴機関要望 >

知的財産権分野における最新発展動向・日本企業や中国企業の知的財産経験のセミナーを開催して欲しい。

日本の裁判所 / 特許庁の審判部と、法律手続き・法律適用などの面で意見交換をしたい。

日本の大学や社会団体と人材養成の協力をお願いしたい。

< 回答 >

について

貴機関の要望はI I P P Fという民間団体に対する内容ではないので、I I P P Fから日本政府へ、貴機関の要望は伝えました。

4月18日～の官民合同ミッションにて、日本政府からの参加者より貴機関の要望に対する確認・回答について発言されると聞いております。

および について

これらの要望に関して、より詳細で具体的な内容について、4月18日～の官民合同ミッション前までに検討していただけると幸いです。

3. 上記計画を推進するにあたっての貴機関の窓口を設定していただきたい。4月の訪中時にご教授下さい。I I P P F側の窓口は、

日本知的財産協会 事務局長 土井 英男

Tel : +81-3-5205-3432、 Fax: +81-3-5205-3391 E-mail: doi@jipa.or.jp

中国国際貿易促進委員会 専利商標事務所 傅 存民

Tel : 66046032、 Fax: 66413211 E-mail: fucm@ccpit-patent.com.cn

となります。

以上